(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-13858 (P2001-13858A)

(43)公開日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.Cl.7

觀別記号

FI C03H 1/08 デーマコート\*(参考) 2K008

G03H 1/08

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 12 頁)

(21)出顧番号

特願平11-183242

(22) 出顧日

平成11年6月29日(1999.6.29)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 北村 満

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72)発明者 浜野 智恒

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74)代理人 100091476

弁理士 志村 浩

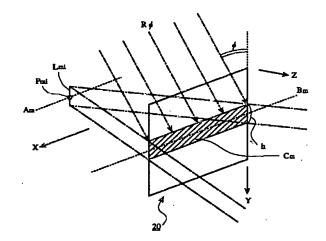
Fターム(参考) 2K008 AA08 AA13 FF27

#### (54) 【発明の名称】 計算機ホログラムおよびその作成方法

### (57)【要約】

【課題】 演算負担を軽減しつつ、明るい再生像を得る.

【解決手段】 原画像上に所定ピッチれで多数の単位線分を定義する。各単位線分Am上に多数の基準点Pmiを定義し、この基準点位置に長されをもち記録面20に平行な線光源しmiを定義する。こうして、原画像を多数の線光源の集合として表現する。記録面20には斜め上方から所定角度ゆをもって参照光Rゆを照射し、幅れをもった単位領域Cm内に、単位線分Am上に配列された全線光源と参照光との干渉縞を演算により記録する。用いる光の波長入および角度ゆを適当に設定すると、単位領域Cm内には、Y軸方向に同一の干渉縞パターンが周期的に繰り返し生じることになるので、1周期分のパターンについてのみ演算を行い、これを必要な分だけ複製する。記録面20上に得られた干渉縞パターンを二値化し、この二値画像を電子線描画装置で媒体上に描画し、エンボスホログラムを作成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 計算機を用いた演算により所定の記録面上に干渉締を形成してなる計算機ホログラムを作成する方法であって、

所定の原画像と、この原画像を記録するための記録面 と、この記録面に対して照射する参照光とを定義する段 際と

前記記録面上に多数の演算点を定義し、個々の演算点に ついて、前記原画像から発せられた物体光と、前記参照 光とによって形成される干渉波の強度を演算する段階 と

個々の演算点について求められた干渉波の強度に基づいて、媒体上に物理的な干渉縞を作成する段階と、 を有し

前記原画像上に分布する複数の基準点を定義するととも に、各基準点を通る線光源を定義し、この線光源から発 せられた物体光と、前記参照光とによって形成される干 渉波の強度を演算するようにしたことを特徴とする計算 機ホログラムの作成方法。

【請求項2】 請求項1に記載の計算機ホログラムの作成方法において、

各線光源として、記録面に対して平行となる所定長さh の線分からなる線光源を定義することを特徴とする計算 機ポログラムの作成方法。

【請求項3】 請求項1または2に記載の計算機ホログラムの作成方法において、

原画像上に複数の単位線分を定義し、各単位線分上にそれぞれ複数の基準点を定義し、これらの各基準点位置に、それぞれ互いに平行となるように線光源を定義することを特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項4】 請求項3に記載の計算機ホログラムの作成方法において、

所定ピッチトをおいて互いに平行となるように複数の切断面を定義し、原画像を前記各切断面で切断した切り口の輪郭線としてそれぞれ単位線分を定義し、これら単位線分上の各基準点について、前記所定ピッチトと同一の長さトをもった線光源を前記各切断面に垂直となるように定義することを特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の計算機 ホログラムの作成方法において、

同一の干渉縞パターンが記録面上に周期的に繰り返し生じるように、参照光の波長および照射角度を設定し、複数 n組の同一の干渉縞パターンが隣接配置されるようにし、1組の干渉縞パターンを作成するために行った強度演算の結果を利用して、他の(n-1)組の同一干渉縞パターンの作成を行うことを特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項6】 請求項5に記載の計算機ホログラムの作成方法において、

多数の画素を用いてホログラムの記録媒体上に物理的な 干渉縞を作成するようにし、干渉縞パターンの繰り返し 周期dの整数倍が前記画素の寸法しの整数倍となるよう に設定する(ただし、d/L≥2)ことを特徴とする計 算機ホログラムの作成方法。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の計算機 ホログラムの作成方法において、

XYZ三次元座標系上に原画像を定義するとともに、この座標系のXY平面上に記録面を定義し、各線光源がY軸に平行となるように設定し、参照光の向きを、YZ平面に対して平行になり、記録面に対して斜めに入射する向きにしたことを特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかの作成方法によって作成された計算機ホログラムの媒体。

【請求項9】 計算機を用いた演算を利用して、所定の 媒体上に原画像を干渉締として記録した計算機ホログラ ムの媒体において、

媒体上に複数の単位領域が定義され、個々の単位領域 は、それぞれ原画像上の特定領域に対応しており、

各単位領域内には、原画像上の対応する特定領域内に配置された互いに平行な線光源に関する情報が記録されていることを特徴とする計算機ホログラムの媒体。

【請求項10】 計算機を用いた演算を利用して、所定の媒体上に原画像を干渉縞として記録した計算機ホログラムの媒体において、

媒体上に複数の単位領域が定義され、個々の単位領域には、それぞれ原画像上の特定領域に関する情報が記録されており、

各単位領域内には、同一の干渉縞パターンが周期的に繰り返し記録されており、かつ、少なくとも同一単位領域内に関しては、繰り返し記録された干渉縞パターンの境界において干渉縞が連続していることを特徴とする計算機ホログラムの媒体。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はホログラムの作成方法に関し、特に、計算機を用いた演算により所定の記録面上に干渉縞を形成してなる計算機ホログラムを作成する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、レーザを利用してコヒーレント光を容易に得ることができるようになり、ホログラムの商業的な利用もかなり普及するに至っている。特に、金券やクレジットカードについては、偽造防止の観点から、媒体の一部にホログラムを形成するのが一般化してきている。

【0003】現在、商業的に利用されているホログラムは、光学的な手法により、原画像を媒体上に干渉縞として記録したものである。すなわち、原画像を構成する物

体を用意し、この物体からの光と参照光とを、レンズなどの光学系を用いて感光剤が塗布された記録面上に導き、この記録面上に干渉縞を形成させるという手法を採っている。この光学的な手法は、鮮明な再生像を得るために、かなり精度の高い光学系を必要とするが、ホログラムを得るための最も直接的な手法であり、産業上では最も広く普及している手法である。

【0004】一方、計算機を用いた演算により記録面上 に干渉縞を形成させ、ホログラムを作成する手法も知ら れており、このような手法で作成されたホログラムは、 一般に「計算機合成ホログラム(CGH:Computer Gen erated Hologram )」、あるいは単に「計算機ホログラ ム」と呼ばれている。この計算機ホログラムは、いわば 光学的な干渉縞の生成プロセスをコンピュータ上でシミ ュレーションすることにより得られるものであり、干渉 縞パターンを生成する過程は、すべてコンピュータ上の 演算として行われる。このような演算によって干渉縞パ ターンの画像データが得られたら、この画像データに基 づいて、実際の媒体上に物理的な干渉縞が形成される。 具体的には、たとえば、コンピュータによって作成され た干渉縞パターンの画像データを電子線描画装置に与 え、媒体上で電子線を走査することにより物理的な干渉 縞を形成する方法が実用化されている。

【0005】コンピュータグラフィックス技術の発展に より、印刷業界では、種々の画像をコンピュータ上で取 り扱うことが一般化しつつある。したがって、ホログラ ムに記録すべき原画像も、コンピュータを利用して得ら れた画像データとして用意することができれば便利であ る。このような要求に応えるためにも、計算機ホログラ ムを作成する技術は重要な技術になってきており、将来 は光学的なホログラム作成手法に取って代わる技術にな るであろうと期待されている。たとえば、特開平11-24539号公報には、再生像の輝度むら発生を抑制す る技術が開示され、特開平11-24540号公報に は、筋状ノイズの発生を抑制する技術が開示され、特開 平11-24541号公報には、より鮮明な再生像を得 る技術が開示されており、再生像の品質を高める試みが なされている。また、特願平10-22604号明細書 には、演算負担を軽減させるための技術が開示され、特 願平11-15871号明細書には、階調画像を取り扱 うための技術が開示され、特願平11-17749号明 細書には、カラー画像を取り扱うための技術が開示され ている。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、計算機ホログラムは、今後大きな需要が見込まれる分野であるが、現時点では、商業的な利用を図る上での解決すべき課題をいくつか抱えている。たとえば、干渉縞を演算する際に、コンピュータに多大な演算負担が課せられる点は、解決すべき重要な課題のひとつである。現在のと

ころ、演算処理能力の優れた超高速コンピュータを用いて、長時間にわたる演算を実行させれば、光学的なホログラムと同等の品質をもった計算機ホログラムを作成することは可能であるが、このような作成方法は商業的に利用することはできない。そこで、実用上は、何らかの手法を用いて、コンピュータの演算負担を軽減させる方法を採らざるを得ない。しかしながら、このような手法を採ることにより、再生像が全体的に暗くなってしまうという別な問題が生じることになる。

【0007】そこで本発明は、演算負担を軽減しつつ、明るい再生像を得ることができる計算機ホログラムの作成方法を提供することを目的とする。

## [0008]

【課題を解決するための手段】(1) 本発明の第1の態様は、計算機を用いた演算により所定の記録面上に干渉縞を形成してなる計算機ポログラムを作成する方法において、所定の原画像と、この原画像を記録するための記録面と、この記録面に対して照射する参照光とを定義する段階と、記録面上に多数の演算点を定義し、個々の演算点について、原画像から発せられた物体光と、参照光とによって形成される干渉波の強度を演算する段階と、個々の演算点について求められた干渉波の強度に基づいて、媒体上に物理的な干渉縞を作成する段階と、を行い、原画像上に分布する複数の基準点を定義するとともに、各基準点を通る線光源を定義し、この線光源から発せられた物体光と、参照光とによって形成される干渉波の強度を演算するようにしたものである。

【0009】(2) 本発明の第2の態様は、上述の第1の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、各線光源として、記録面に対して平行となる所定長されの線分からなる線光源を定義するようにしたものである。【0010】(3) 本発明の第3の態様は、上述の第1または第2の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、原画像上に複数の単位線分を定義し、各単位線分上にそれぞれ複数の基準点を定義し、これらの各基準点位置に、それぞれ互いに平行となるように線光源を定義するようにしたものである。

【0011】(4) 本発明の第4の態様は、上述の第3の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、所定ピッチトをおいて互いに平行となるように複数の切断面を定義し、原画像を各切断面で切断した切り口の輪郭線としてそれぞれ単位線分を定義し、これら単位線分上の各基準点について、所定ピッチトと同一の長さトをもった線光源を各切断面に垂直となるように定義するようにしたものである。

【0012】(5) 本発明の第5の態様は、上述の第1 〜第4の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、同一の干渉縞パターンが記録面上に周期的に繰り返し生じるように、参照光の波長および照射角度を設定し、複数n組の同一の干渉縞パターンが隣接配置される ようにし、1組の干渉縞パターンを作成するために行った強度演算の結果を利用して、他の(n-1)組の同一干渉縞パターンの作成を行うようにしたものである。

【0013】(6) 本発明の第6の態様は、上述の第5の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、多数の画素を用いてホログラムの記録媒体上に物理的な干渉縞を作成するようにし、干渉縞パターンの繰り返し周期dの整数倍が画素の寸法Lの整数倍となるように設定(ただし、d/L≥2)したものである。

【0014】(7) 本発明の第7の態様は、上述の第1~第6の態様に係る計算機ホログラムの作成方法において、XYZ三次元座標系上に原画像を定義するとともに、この座標系のXY平面上に記録面を定義し、各線光源がY軸に平行となるように設定し、参照光の向きを、YZ平面に対して平行になり、記録面に対して斜めに入射する向きとなるようにしたものである。

【0015】(8) 本発明の第8の態様は、上述の第1 〜第7の態様に係る計算機ホログラムの作成方法によって、計算機ホログラムの媒体を作成するようにしたものである。

【 O O 1 6 】 (9) 本発明の第9の態様は、計算機を用いた演算を利用して、所定の媒体上に原画像を干渉縞として記録した計算機ホログラムの媒体において、媒体上に複数の単位領域を定義し、個々の単位領域に、それぞれ原画像上の特定領域を対応させ、各単位領域内には、原画像上の対応する特定領域内に配置された互いに平行な線光源に関する情報が記録されるようにしたものである

【0017】(10) 本発明の第10の態様は、計算機を用いた演算を利用して、所定の媒体上に原画像を干渉縞として記録した計算機ホログラムの媒体において、媒体上に複数の単位領域を定義し、個々の単位領域には、それぞれ原画像上の特定領域に関する情報が記録されるようにし、各単位領域内には、同一の干渉縞パターンが周期的に繰り返し記録され、かつ、少なくとも同一単位領域内に関しては、繰り返し記録された干渉縞パターンの境界において干渉縞が連続しているようにしたものである。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図示する実施形態 に基づいて説明する。

【0019】81. 計算機ホログラムの基本原理図1は、一般的なホログラムの作成方法を示す原理図であり、原画像10を記録面20上に干渉縞として記録する方法が示されている。ここでは、説明の便宜上、図示のとおりXYZ三次元座標系を定義し、記録面20がXY平面上に置かれているものとする。光学的な手法を採る場合、記録対象となる物体が原画像10として用意されることになる。この原画像10上の任意の点Pから発せられた物体光0は、記録面20の全面に向けて進行す

る。一方、記録面20には、参照光Rが照射されており、物体光Oと参照光Rとの干渉縞が記録面20上に記録されることになる。

【0020】記録面20の位置に計算機ホログラムを作 成するには、原画像10、記録面20、参照光Rを、コ ンピュータ上にデータとしてそれぞれ定義し、記録面2 0上の各位置における干渉波強度を演算すればよい。 具 体的には、たとえば図2に示すように、原画像10をN 個の点光源P1, P2, P3, …, Pi, …, PNの集 合として取り扱い、各点光源からの物体光〇1,〇2, O3, …, Oi, …, ONが、それぞれ演算点Q(x, y)へと進行するとともに、参照光Rが演算点Q(x, y)に向けて照射されたものとし、これらN本の物体光 O1~ONと参照光Rとの干渉によって生じる干渉波の 演算点Q(x,y)の位置における振幅強度を求める演 算を行えばよい。物体光および参照光は、通常、単色光 として演算が行われる。記録面20上には、必要な解像 度に応じた多数の演算点を定義するようにし、これら各 演算点のそれぞれについて、振幅強度を求める演算を行 えば、記録面20上には干渉波の強度分布が得られるこ とになる。

【0021】このような強度分布を示す画像データに基 づいて、実際の媒体上に物理的な濃淡パターンやエンボ スパターンを形成すれば、原画像10を干渉縞として記 録したホログラムが作成できる。媒体上に高解像度の干 渉縞を形成する手法としては、電子線描画装置を用いた 描画が適している。電子線描画装置は、半導体集積回路 のマスクパターンを描画する用途などに広く利用されて おり、電子線を高精度で走査する機能を有している。そ こで、演算によって求めた干渉波の強度分布を示す画像 データを電子線描画装置に与えて電子線を走査すれば、 この強度分布に応じた干渉縞パターンを描画することが できる。ただ、一般的な電子線描画装置は、描画/非描 画を制御することにより二値画像を描画する機能しか有 していない。そこで、演算によって求めた強度分布を二 値化して二値画像を作成し、この二値画像データを電子 線描画装置に与えるようにすればよい。

【0022】図3は、このような二値化処理の概念図である。上述した演算により、記録面20上の各演算点Q(x,y)には、所定の振幅強度値が定義されることになる。そこで、この振幅強度値に対して所定のしきい値(たとえば、記録面20上に分布する全振幅強度値の平均値)を設定し、このしきい値以上の強度値をもつ演算点には画素値「1」を与え、このしきい値未満の強度値をもつ演算点には画素値「0」を与えるようにし、各演算点Q(x,y)を、「1」もしくは「0」の画素値をもつ画素D(x,y)に変換すれば、多数の画素D(x,y)の集合からなる二値画像が得られる。この二値画像のデータを電子線描画装置に与えて描画を行えば、物理的な二値画像として干渉縞を描画することがで

きる。実際には、この物理的に描画された干渉縞に基づいて、たとえばエンボス版を作成し、このエンボス版を 用いたエンボス加工を行うことにより、表面に干渉縞が 凹凸構造として形成されたホログラムを量産することが できる。

【0023】§2. 演算負担を軽減させるために従来 提案されている方法

計算機ホログラムを作成する基本原理は、上述したとおりである。ただ、高い品質をもった再生像を得るためには、記録面20に記録される干渉縞の解像度を高めるとともに、原画像10自体の解像度を高める必要がある。別言すれば、記録面20上に定義する演算点Qの数を増やすとともに、原画像10を構成する点光源Pの数を増やす必要があり、コンピュータの演算負担は両者の積に応じて増大することになる。このため、現在の一般的なコンピュータの処理能力を考慮すると、このような手法によって作成された計算機ホログラムを商業的に利用するのは困難である。

【0024】そこで、たとえば、特願平10-2260 4号明細書などには、演算負担を軽減させるための実用 的な手法が開示されている。ここでは、この手法を簡単 に説明しておく。

【0025】いま、図4(a) に示すように、原画像10 上に所定ピッチhをおいて互いに平行となるように複数 M本の単位線分A1, …, Am-1, Am, Am+1, …, AMを定義する。実際には、所定ピッチhをおいて 互いに平行となるように複数の切断面を定義し、原画像 を各切断面で切断した切り口の輪郭線としてそれぞれの 単位線分を定義すればよい。なお、任意形状の立体など を像として記録する場合、原画像10が任意曲面になる ため、この任意曲面上に定義された単位線分は、「曲線 分」を形成することになる。したがって、本明細書にお ける「単位線分」という文言は、「直線分」だけでなく 「曲線分」も含めた意味で用いることにする。こうし て、M本の単位線分が定義されたら、続いて、各単位線 分上にそれぞれ複数の基準点を定義する。たとえば、図 4(a) には、第m番目の単位線分Am上にN個の基準点 Pm1, …, Pmi, …, PmNを定義した例が示され ている。各基準点は、たとえば、単位線分上に所定ピッ チで配置すればよい。

【0026】一方、図4(b) に示すように、記録面20上には、M本の投影線分B1,…,Bm-1,Bm,Bm+1,…,BM(図では破線で示す)を定義する。これら各投影線分は、それぞれ原画像10上に定義された単位線分A1,…,Am-1,Am,Am+1,…,AMを、記録面20上に投影したときに得られる投影像であり、前述の切断面で記録面20を切断したときの切り口に相当する。そして、各投影線分を、当該投影線分に直交する方向に+h/2および-を切断したときの切り口とにより(図4(b) では、上下にそれぞれh/2の

幅だけ移動させることにより)、幅hをもった帯状の単位領域C1,…,Cm-1,Cm,Cm+1,…,CM を形成する。図4(b) では、第m番目の投影線分Bmを上下に移動させることにより形成された第m番目の単位領域Cmが、ハッチング表示されている。結局、原画像10上のM本の単位線分A1,…,Am-1,Am,Am+1,…,AMと、記録面20上のM個の単位領域C1,…,Cm-1,Cm,Cm+1,…,CMとが1対1に対応することになる。

【0027】原画像10の情報を記録面20に記録する には、既に述べたように、記録面20上に定義された多 数の演算点Qの位置について、原画像10上に定義され た多数の点光源Pからの物体光と、参照光Rとの干渉波 の強度を演算することになる。そこで、各単位線分A 1, …, Am-1, Am, Am+1, …, AM上の各基 準点の位置にそれぞれ点光源を定義し、これらの点光源 からの物体光と参照光Rとの干渉波の強度演算を行うこ とになるが、このとき、第m番目の単位領域Cm内の演 算点Qについては、対応する第m番目の単位線分Am上 のN個の基準点Pm1, ···, Pmi, ···, PmN上の点 光源からの物体光のみを考慮した演算を行うようにす る。すなわち、図4(b) においてハッチングが施された 領域内の演算点については、単位線分Am上のN個の基 準点Pm1, …, Pmi, …, PmN上の点光源につい ての情報のみが記録されることになる。

【0028】図5は、上述の基本原理を説明するため に、記録に必要な系を記録面20の背面側からみた状態 を示す図である。ここでは、XYZ三次元座標系が定義 されており、記録面20は、XY平面上に置かれてい る。また、説明の便宜上、原画像10については、第m 番目の単位線分Amのみが示されており、記録面20上 には、第m番目の投影線分Bmを中心として幅hをもつ 第m番目の単位領域Cm(ハッチングを施した細長い矩 形領域)のみが示されている。単位線分Am上には、多 数の基準点が定義されており、これらの基準点位置に定 義された点光源からの物体光と所定の参照光との干渉縞 が、記録面20上に定義された単位領域Cm上の各演算 点に記録されることになる。このような干渉縞を記録す る演算は、個々の点光源に着目すれば、ある基準点Pm i 上の点光源から発せられた物体光(図では一点鎖線で 示す)のY軸方向に関する広がり角を、図5に示す所定 角をに制限した演算ということができる。この例では、 物体光のX軸方向に関する広がりは制限されていないた め、単位線分Am上のすべての基準点Pm1, Pm2, Pm3, …, Pmi, …, PmNから発せられた物体光 は、横幅が記録面20の横幅に等しく、縦幅が角度をに 応じて定まる寸法hとなる矩形状の単位領域Cmに照射 されることになる。

【0029】一方、参照光Røは、図のようにXYZ三次元座標系を定義した場合に、YZ平面に平行な平面に

沿って進む平面波であり、記録面20に対して入射角 ¢ をもって斜め上方から照射される光である。もちろん、参照光R ¢ の照射方向は、理論的にはどのような方向から入射させてもよいが、実用上は、図示の例のように、Y Z 平面に平行になり、記録面20に対して斜め上方から入射するようにするのが好ましい。これは、記録媒体20に記録されたホログラムを、クレジットカード用の偽造防止用マークなどとして利用する場合、斜め上方からの再生用照明光を用いて観察する場合が多いからである。このような参照光R ¢ を用いて作成されたホログラムは、天井照明からの光など、斜め上方から照射される再生光の下で最適な再生像を提示できる。

【0030】本来のホログラム像を記録するのであれば、個々の演算点ごとに、図4(a)に示す原画像10上のすべての点光源からの物体光を考慮した演算を行う必要があるが、上述した手法によれば、1本の単位線分上に位置する点光源からの物体光のみを考慮した演算ですむため、演算負担は大幅に軽減される。

【0031】なお、記録面20上に定義される各単位領域のY軸方向の幅h(縦方向の幅)は、視覚的に認識不可能な寸法(肉眼の解像度よりも更に高い解像度を実現できる寸法)に設定するのが好ましい。これは、幅hを視覚的に認識可能な寸法に設定した場合、記録面20を全体的に観察した際に、各単位領域の境界線が肉眼で認識されてしまい、全体的に横縞模様が観察されるおそれがあるからである。たとえば、h=1mm程度(視覚的に十分認識可能な寸法)に設定した場合、再生像に幅1mmの横縞が重なって観察されることになる。具体的には、h<100μm以下、より好ましくはh<50μm以下に設定すると、ほとんどの場合、横縞模様は認識されなくなる。これに対して、単位領域のX軸方向の幅は、記録面20の横幅に等しくなるため、当然、視覚的に認識可能な寸法になる。

【0032】§3. 本発明に係る計算機ホログラムの作成方法

本発明に係る計算機ホログラムの作成方法は、上述した § 1 および § 2 で述べた手法を更に改良した方法であ り、その基本概念は、点光源の代わりに線光源を用いた 演算を行う点にある。たとえば、図5 に示す方法では、基準点 P m i 上に点光源を定義し、この点光源からの物体光と参照光 R ゆとの干渉縞を記録している。一般に、点光源からの光は、波面が球状となるように広がってゆく光であり、基準点 P m i 上に位置する点光源から進む 物体光を X Z 平面または Y Z 平面上に投影した場合、図6 に一点鎖線で示すような投影像が得られることになる。したがって、本来であれば、点光源からの物体光は、記録面 2 0 の全面に到達することになるが、§ 2 で述べた手法では、図5 に示すように、物体光の Y 軸方向に関する広がり角を、所定角 をに制限した演算を行うため、基準点 P m i 上の点光源からの物体光は、単位領域

Cm内にのみ到達することになる。

【0033】これに対し、本発明では、原画像10上に 多数の線光源を定義することになる。たとえば、図7に 示すように、基準点Pmi上に線光源Lmiを定義し、 この線光源Lmiからの物体光と参照光Rφとの干渉縞 を記録面20上に記録する場合を考えてみる。ここで、 線光源Lmiは、記録面20に対して平行で、長さhの 線分から構成されているものとする。より具体的には、 図7に示す例では、Y軸に平行になるように線光源Lm iを定義してあり、この線光源Lmiの中心が基準点P miの位置にくるようにしてある。ここでは、単位線分 Am, BmがX軸に平行になり、記録面20がXY平面 上にくるようにXYZ三次元座標系を定義してあるた め、線光源LmiはY軸に平行になる。線光源Lmi は、一様な強度をもった線状の光放射要素であり、その 強度値は、たとえば、原画像10上の基準点Pmiが有 する画素値に基づいて決定すればよい。一般に、線光源 からの光は、波面が円筒状となるように広がってゆく光 であり、基準点Pmi上の線光源Lmiから進む物体光 をXZ平面上に投影すると、図6に一点鎖線で示すよう な投影像が得られることになるが、これをYZ平面上に 投影すると、図8に一点鎖線で示すような投影像が得ら れることになる。

【0034】別言すれば、図7に示す系を上方向から観 察すると、線光源Lmiからの物体光は図6に示すよう に放射状に広がってゆくことになるが、この系を横方向 から観察すると、線光源Lmiからの物体光は、図8に 示すように、いずれも水平方向に進む光となる。結局、 線光源Lmiからの物体光は、その広がり角に何ら制限 を加えなくても、Y軸方向について幅hをもった単位領 域Сm内にのみ到達することになる。こうして、単位領 域Cm内の各演算点について、線光源Lmiからの物体 光と参照光R々との干渉波の強度が演算されることにな り、単位領域Cm内に干渉縞が記録されることになる。 【0035】図7では、図示の便宜上、単位線分Am上 の第i番目の基準点Pmi上に定義された線光源Lmi からの物体光と参照光Rφとの干渉縞が単位領域Cm内 に記録される様子のみが示されているが、実際には、単 位線分Am上にはN個の基準点Pm1~PmNが定義さ れており、各基準点の位置にそれぞれ線光源Lm1~L mNが定義される(いずれの線光源も長さhを有し、そ の中心が単位線分Am上にくるように、Y軸に平行な向 きに配置されている)。したがって、単位領域Cm内に は、N個の線光源Lmi~LmNからの各物体光と参照 光R々との干渉縞が重ねて記録されることになる。

【0036】また、図4(a) に示すように、原画像10 上には、所定ピッチhをおいて互いに平行になるよう に、M本の単位線分A1~AMが定義されており(いずれもX2平面に平行な線分もしくは曲線分となる)、これらすべての単位線分上にそれぞれ複数の基準点が定義 され、各基準点について、それぞれ各単位線分に垂直となる(Y軸に平行となる)線光源が定義されている。したがって、図4(b) に示すM個のすべての単位領域C1~CMについて、それぞれ対応する単位線分A1~AM上の複数の基準点に定義された線光源からの物体光と参照光との干渉縞が記録されることになる。

【0037】§4. 線光源を用いるメリット

このように、§ 1 および § 2 で述べた従来の方法と、§ 3 で述べた本発明に係る方法との根本的な相違点は、前者では各基準点上に配置された点光源についての情報を記録するのに対し、後者では各基準点上に配置された線光源についての情報を記録するという点にある。本願発明者は、点光源の代わりに線光源を用いることにより、2 つのメリットが得られることを見出だした。第1 のメリットは、より明るい再生像を得ることができるというメリットであり、第2のメリットは、干渉縞を得るための演算負担を軽減させることができるというメリットである。以下、これら2 つのメリットについて順に説明する。

【0038】第1のメリットである明るい再生像が得ら れる理由は、次のように考えることができる。いま、図 9に示す点光源モデルと図10に示す線光源モデルとを 考えてみる。図9に示す点光源モデルは、§2で説明し た従来の点光源を用いて原画像を記録した計算機ホログ ラム (図5の手法)を再生する場合のモデルであり、図 10に示す線光源モデルは、§3で説明した本発明に係 る線光源を用いて原画像を記録した計算機ホログラム (図7の手法)を再生する場合のモデルである。いずれ のモデルも、横方向から見た側面図を示しており、記録 面20の左側に原画像をおき、同じく左側から参照光R φ (一点鎖線で示す)を照射して干渉縞を記録し、この 干渉縞を記録面20の右側の視点Eから観察したときの 再生状態を示している。再生時には、参照光R々と同じ 方向から再生用照明光を照射することになる(実際に は、再生用照明光は、記録面20の右側から照射される ことが多いが、この場合の再生用照明光は記録面20を 鏡面とした場合に参照光R φと鏡像関係となる方向から

【0039】さて、ここで記録面20の幅hの部分の領域(単位領域Cm)に記録されている干渉縞に基づいて再生される原画像の一部分を考えてみると、図9に示す点光源モデルの場合は基準点Pmi上の点光源が再生されるのに対し、図10に示す線光源モデルの場合は線光源Lmiが再生されることになる。前者の場合、物体光〇(実線で示す)は、基準点Pmiから広がってゆく。視点Eに向かう再生光(破線で示す)は、この物体光の延長線上にあるので、図9に示すように、再生光は上下に広がる光となる。ところが、後者の場合、物体光〇(実線で示す)は、線光源Lmiから平行のまま進むことになる。やはり視点Eに向かう再生光(破線で示す)

は、この物体光の延長線上にあるので、図10に示すように、再生光は平行のまま進む光となる。結局、図9に示す点光源モデルでは、再生光が上下に分散してしまう傾向にあるのに対し、図10に示す線光源モデルでは、そのような再生光の分散は生じないことになる。このような理由から、図示のように、再生光の進行方向に視点Eを置いてみる限りにおいては、前者よりも後者の方が視点Eに集まる再生光の光量は多くなり、明るく見えることになる。

【0040】もっとも、視点Eの位置を変えると、メリットはデメリットに転じてしまう。たとえば、視点Eの位置を図示の位置よりも上に移動させ、斜め上方から見下ろすようにして光源の像を観察したとすると、後者では、再生光が全く視点Eに届かなくなり再生像は全く見えなくなるのに対し、前者では一部の再生光が視点Eに届くことになり、再生像はいくらか見えることになる。別言すれば、図9に示す点光源モデルでは、上下方向に関する像の観察範囲が広く設定されているのに対し、図10に示す線光源モデルでは、上下方向に関する像の観察範囲が狭く設定されていることになる。

【0041】ただ、クレジットカードの偽造防止用マークなどへの利用を考慮すると、通常は、記録面20の垂直上方に視点Eを置いて観察する頻度が高いと考えられるので、たとえ観察範囲が狭くなったとしても、垂直上方に視点Eを置いて観察したときに最も明るい再生像が得られる図10に示す線光源モデルの方がより好ましいと言うことができる。これが本発明の第1のメリットである。

【0042】第2のメリットである「干渉縞を得るため の演算負担を軽減させることができる」という理由は次 のとおりである。まず、図11と図12とを比較してみ て欲しい。図11は、図9に示す点光源モデルにおける 1つの単位領域内に記録される干渉縞のパターンの模式 図であり、図12は、図10に示す線光源モデルにおけ る1つの単位領域内に記録される干渉縞のパターンの模 式図である(いずれも、干渉縞パターンを模式的に示し たものであり、実際の干渉縞を示すものではない)。両 者を比べると、図12に示すパターンでは、全体を縦方 向に4分割することができ、このような分割を行った場 合、各分割領域内には、全く同一の干渉縞パターンが形 成されていることがわかる。すなわち、縦幅dからなる 4つの分割領域内の干渉縞パターンは、いずれも全く同 一のパターンとなっている。図11に示すパターンを縦 方向に4分割して分割領域を形成したとしても、各分割 領域内のパターンは同一にはならない。

【0043】図12に示すように、同一の干渉縞パターンが記録面上で周期dをもって繰り返し隣接配置されることが予めわかっていれば、干渉縞を得るための演算負担を軽減させることが可能である。すなわち、複数 n 組の同一の干渉縞パターンが隣接配置されることが予めわ

かっていれば、1組の干渉縞パターンを作成するために 行った強度演算の結果を利用して、他の(n-1)組の 同一干渉縞パターンの作成を行うことができるので、演 算回数を1/nにまで減らすことが可能になる。たとえ ば、図12に示す例では、複数4組の同一の干渉縞パタ ーンが周期dをもって隣接配置されることが予めわかっ ているので、この単位領域については、全幅hのすべて の領域について干渉縞演算を行う必要はなく、たとえ ば、幅 dからなる 1 組の分割領域 (全体の 1/4の領 域)について干渉縞演算を行い、残りの3組の分割領域 については、第1組目の演算によって求めた干渉縞パタ ーンを複製して配置するようにすれば足りる。このよう に同一干渉縞パターンを複製して利用することができれ ば、演算負担を軽減するというメリットとともに、パタ ーン描画に必要な総データ量を軽減できるという付随的 なメリットも得られるようになる。このメリットによ り、電子線描画装置などを用いて干渉縞パターンを描画 する際には、データの受け渡し効率が著しく改善され

【0044】このように、線光源を用いた場合に、同一の干渉縞パターンの繰り返しが生じる理由を、図10のモデルを用いて簡単に説明してみよう。まず、線光源しmiからは、いずれの部分からも、図の右方向に物体光〇が照射される。ここで、線光源しmiは、長さ方向に均一な強度をもった光源であり、しかも記録面20に対して平行であるから、記録面20上で長さhをもった単位領域内のどの位置についても、物体光〇は同一の条件で照射されていることになり、その振幅強度および位相は全く同一になる。このように、物体光〇が全く同一条件で照射されているにもかかわらず、この単位領域に干渉縞パターンが形成されるのは、参照光Rφの位相が各部分で異なるためである。

【0045】いま、参照光R φを構成する光束として、 図示のように、5本の光束R1~R5を考える。もとも と参照光Rφは、空間的にコヒーレントな光であるか ら、この5本の光束の位相はすべて揃っている。しかし ながら、記録面20に対しては、斜めの角度 φで入射す るため、記録面20に到達するまでの光路長はそれぞれ で異なり、到達点F1~F5におけるそれぞれの位相は 互いに異なることになる。たとえば、光束R1の光路長 よりも光束R2の光路長は所定長だけ長くなり、光束R 2の光路長よりも光束R3の光路長は所定長だけ長くな る。ここでは、この光路長の差がちょうど1波長分であ ったとすると、点F1, F2では、参照光 $R\phi$ の位相が 2πだけ異なっていることになり、到達点F2, F3で も、参照光Rφの位相が2πだけ異なっていることにな る。結局、5つの到達点F1~F5の間では、いずれも 参照光Rφの位相が2πずつずれていることになる。こ のような理由から、記録面20上には、周期 dをもった 同一の干渉縞パターンが4回繰り返し現れることにな

り、図12に示すような干渉縞パターンが得られることになる。

【0046】これに対して、点光源を用いた場合は、図9に示すように、記録面20上における参照光R Φの位相は周期dで繰り返されるが、物体光Oの位相が各位置ごとに異なるため、幅hを有する単位区間内全体としては、繰り返しパターンが得られることはない。

【0047】線光源を用いた場合に得られる干渉縞パターンの繰り返しの周期dは、図13に示す式によって予め求めることができる。すなわち、図13上段に示すように、物体光Oと参照光Rの照射角度を考え、記録面20上に立てた法線方向を角度の基準として、物体光Oの進行角度を $\theta$ っとし、参照光Rの進行角度を $\theta$ rとし、用いる光(物体光および参照光)の波長を入とすれば、記録面20上に現れる干渉縞パターンの繰り返し周期dは、図13の下段に示すように、

 $d = \lambda / |\sin \theta r - \sin \theta o|$ 

によって求まることになる。なお、物体光Oは視点Eに 向けて図の右方向へと進むので、常に $\theta$ o=0になる。 また、前述の例では、 $\theta r = \phi$ である。もちろん、繰り 返し周期dが、線光源の長さhよりも長くなってしまう と、もはや繰り返しパターンは得られなくなる。したが って、演算負担を軽減するために繰り返しパターンを得 るためには、d<hとなるように、用いる光の波長λお よび参照光の照射角度  $\theta$  r を適当な値に設定する必要が ある。より好ましくは、hがdの整数倍となるようにす れば、記録面20上で同一の干渉縞パターンを整数回だ け複製する処理を行えばよいので、演算負担は更に軽減 される(hがdの整数倍でない場合、たとえば、hがd の3.7倍となっていたような場合、同一の干渉縞パタ ーンを2回だけ複製した後、このパターンの幅の7/1 0の部分だけを複製する処理が必要になり、処理がやや 煩雑になる)。

【0048】なお、繰り返し周期dを設定するにあたっては、もうひとつ留意すべき点がある。それは、干渉縞を物理的媒体に記録する際の画素の寸法を考慮するという点である。既に述べたように、演算で得られた干渉縞パターンを物理的媒体に実際に記録する場合、電子線描画装置などが用いられている。このような描画装置では、干渉縞パターンが矩形の画素の集合として描画されることになるので、干渉縞パターンの周期dは、この画素の寸法の整数倍となるように設定したおいた方が都合がよい。たとえば、 $\lambda=633nm$ ,  $\theta r=45^\circ$ ,  $\theta$ 0=0°に設定すると、上述の式により、d=895.19……nmといった半端な数値になってしまう。このような半端な寸法値が出てしまうと、一般的な電子線描画装置で描画を行う場合に支障が生じる。

【0049】たとえば、用いる電子線描画装置のサンプリング間隔が200nmであったとすると、この描画装置を用いて作成される干渉縞パターンは、寸法200n

mの画素の集合として描画されることになる。したがって、周期dが、この200nmの整数倍となっていると、描画を行う上では非常に都合がよい。一例として、周期dをこのサンプリング間隔200nmの4倍に設定するのであれば、d=800nmに設定すればよい。このように周期dを先に決め、上述の式を適用すれば、たとえば、 $\lambda=565.685$ nm,  $\theta r=45^\circ$ ,  $\theta \circ =0^\circ$ という値が設定できる。ここで波長入は、半端な値となっており、実際には、このような波長をもった光源は存在しないかもしれないが、計算機ホログラムの場合、波長入は演算に用いる単なる数値としての意味しかもたないので、何ら問題は生じない。

【0050】図14は、このような条件で実際に描画された干渉縞パターンを示す図である。電子出願の制約上、図の細かな部分は鮮明に表現することができないが、周期dをもって同一の干渉縞パターンが繰り返されている様子がある程度は認識できる。図15は、周期はに相当する1回分の干渉縞パターンのみを抽出して示す図である。ここでは、d=800nm、h=8μmとなっており、サンプリング間隔は200nmである。したがって、図15に示す1周期分の干渉縞パターンは縦方向に並んだ4画素分から構成されており、図14に示す1単位領域分の干渉縞パターンは、図15に示す周期パターンを縦方向に10回分並べたものとなる。もちろん、干渉縞パターンを求める演算は、図15に示す1周期分のパターンについてのみ行えば足り、残りの9周期分については、これを複製する処理を行えばよい。

【0051】なお、周期dは、必ずしも描画装置の画素 寸法の整数倍にする必要はなく、周期dの2倍が画素寸法の整数倍となるような設定でもかまわない。たとえば、上述の例では、画素寸法200nmに対して、周期d=800nmに設定しているが、周期d=700nmに設定することも可能である。d=700nmにすると、周期d自体は画素寸法の整数倍にはなっていないが、周期dの2倍である1400nmが画素寸法200nmの整数倍となっているため、この干渉結パターンを、周期2dのパターンとして取り扱えば、描画を行う上では問題は生じないことになる。結局、周期dの整数倍が画素寸法の整数倍となるような設定を行えばよいことになる。ただし、サンプリング定理により、周期dが画素寸法しの2倍以上になるように設定しないと干渉稿を記録することはできない。

【0052】§4. 本発明に係る計算機ホログラム媒体。 の構成

以上述べたように、本発明に係る計算機ホログラムによれば、明るい再生像を得ることができるという第1のメリットと、作成時の演算負担を軽減させるという第2のメリットとが得られる。ここでは、このようなメリットを生むことができる計算機ホログラム媒体自体の構成を述べておこう。

【0053】まず、この計算機ホログラム媒体には、複 数の単位領域が定義されており、個々の単位領域は、そ れぞれ原画像上の特定領域に対応していることになる。 たとえば、図4(b) に示すような記録面20をもった媒 体の場合、合計M個の単位領域C1~CMが定義されて おり、各単位領域は、それぞれ原画像10上の特定領 域、すなわち、単位線分A1~AMに相当する領域に対 応している。そして、各単位領域内には、原画像上の対 応する特定領域に、媒体と平行となるように配置された 線光源に関する情報が記録されている。 たとえば、図4 (b) に示す第m番目の単位領域Cm内には、原画像10 上の対応する単位線分Am上の基準点Pm1~PmNに 配置された線光源(記録面20に平行)に関する情報が 記録されていることになる。このように、線光源の情報 が記録されていると、図10のモデルで説明したよう に、再生光が分散することなく、視点Eの位置に集まる という効果が得られるため、全体的に明るい再生像が得 られることになる。

【0054】また、作成時の演算負担の軽減というメリ ットに着目すると、この計算機ホログラムの各単位領域 内には、図12に示すように、周期dをもった同一の干 渉縞パターンが周期的に繰り返し記録されていることに なる。しかも、単に繰り返し記録されているだけではな く、この単位領域内に関する限りは、繰り返し記録され た干渉縞パターンの境界において干渉縞が連続してい る。すなわち、図12に示す干渉縞パターンは、幅hに わたって連続的なパターンとなっており、繰り返し周期 dごとの境界部分においても連続的なパターンとなって いる。これは、演算負担を軽減するための処理を行って いるにもかかわらず、その結果として、原画像の情報量 の低減が生じないことを意味する。別言すれば、図12 において、全幅h内の全演算点について実際に演算を行 って干渉縞パターンを形成した場合でも、全幅hのうち の周期 d に相当する 1 / 4 の領域内の演算点についての み実際に演算を行った干渉縞パターンを形成し、これを 複写することにより全幅hについての干渉縞パターンを 得たとしても、全く同一の結果が得られるのである。

【0055】前掲の公報などには、計算機ホログラム作成時の演算負担を軽減するための種々の方法が開示されている。しかしながら、従来開示されている方法では、演算負担軽減策によって原画像の情報量が低減されてしまうため、再生像の品質が低下するという問題が生じざるを得ない。本発明に係る方法によれば、演算負担の軽減策を採っても採らなくても、全く同一の再生像品質が得られる。

【0056】以上、本発明を図示する実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、この他にも種々の形態で実施可能である。たとえば、本発明で用いる原画像は、平面的な像であってもよいし、立体的な像であってもよい。もちろ

ん、階調画像やカラー画像を記録する方法(前掲各公報に記載されている方法)にも本発明は適用することが可能である。また、上述の実施形態では、各線光源が記録面に対して平行になるように設定しているが、明るい再生像を得るというメリットを得る目的であれば、各線光源は近いに平行になるようにした方が好ましい。また、実用上は、記録面に対して垂直上方から観察したときに最も明るい再生像が得られるようにするのが好ましく、この観点からは、各線光源を記録面に対して平行に設定するのが好ましい。更に、本発明は前掲の特願平11-15871号明細書に開示された方法にも適用可能であり、この場合は原画像を階調をもった画像として記録再生することができるようになる。

#### [0057]

【発明の効果】以上のとおり本発明に係る計算機ホログラムの作成方法によれば、作成時の演算負担を軽減しつつ、明るい再生像を得ることができるようになる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】一般的なホログラムの作成方法を示す原理図であり、原画像10を記録面20上に干渉縞として記録する方法が示されている。

【図2】図1に示す原理に基づいて、記録面上の任意の 点Q(x,y)における干渉波の強度を演算する方法を 示す図である。

【図3】演算によって得られた強度分布画像を二値化 し、二値画像を得る過程を示す概念図である。

【図4】本発明に係る計算機ホログラムの作成方法の一 実施形態において、原画像10上に定義された単位線分 と、記録面20上に定義された単位領域とを示す図であ る。

【図5】原画像上の点光源からの物体光を記録面20に 記録する従来の方法を示す斜視図である。

【図6】点光源から照射される物体光の進行方向を示す 図である。

【図7】原画像上の線光源からの物体光を記録面20に 記録する本発明の方法を示す斜視図である。

【図8】線光源から照射される物体光の進行方向を示す 図である。

【図9】点光源からの物体光と参照光との干渉縞を記録

した際の再生光の進行方向を示す側面図である。

【図10】線光源からの物体光と参照光との干渉縞を記録した際の再生光の進行方向を示す側面図である。

【図11】点光源からの物体光と参照光とによって生じる干渉縞パターンの一例を示す平面図である。

【図12】線光源からの物体光と参照光とによって生じる干渉縞パターンの一例を示す平面図である。

【図13】線光源からの物体光と参照光とによって生じる干渉縞パターンが周期パターンとなることを示す原理図である。

【図14】本発明に係る方法で記録された1単位領域分の干渉縞パターンの一例を示す平面図である。

【図15】図14に示す干渉縞パターンの1周期分のみを示す平面図である。

### 【符号の説明】

10…原画像

20…記録面

A 1 , A m − 1 , A m , A m + 1 , A M…原画像上の単 付線分

B1, Bm-1, Bm, Bm+1, BM…記録面上の投 影線分

C1, Cm-1, Cm, Cm+1, CM…単位領域

D(x, y)…二値画像を構成する画素

d…干渉縞パターンの繰り返し周期

E…視点

F1~F5…参照光の到達点

h…単位領域の縦幅/単位線分のピッチ

Lm i …線光源

O, O1, Oi, ON…物体光

P, P1, Pi, PN, Pm1, Pmi, PmN…点光源/基準点

Q(x,y)…演算点

R, R φ…参照光 (再生光)

R1~R5…参照光の光束

θο…物体光の照射角度

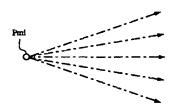
θ r…参照光の照射角度

φ…参照光の入射角

€…物体光のY軸方向に関する広がり角

λ…物体光および参照光の波長

【図6】



【図11】

